

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成20年8月21日(2008.8.21)

【公表番号】特表2008-510634(P2008-510634A)

【公表日】平成20年4月10日(2008.4.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-014

【出願番号】特願2007-528027(P2007-528027)

【国際特許分類】

B 4 1 N	1/14	(2006.01)
G 0 3 F	7/00	(2006.01)
G 0 3 F	7/032	(2006.01)
G 0 3 F	7/021	(2006.01)
G 0 3 F	7/11	(2006.01)

【F I】

B 4 1 N	1/14	
G 0 3 F	7/00	5 0 3
G 0 3 F	7/032	
G 0 3 F	7/021	5 0 1
G 0 3 F	7/11	5 0 3

【手続補正書】

【提出日】平成20年7月1日(2008.7.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

順番に、支持体、シリケート層、及び中間層を含んで成る基板：ここで、

該支持体はアルミニウム又はアルミニウム合金を含み；

該中間層は中間層材料を含み；

該中間層材料は、KユニットとLユニットとを含むコポリマーであり；

該Kユニットは、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>1</sup>)C(O)(OCH<sub>2</sub>CH(R<sup>5</sup>))<sub>m</sub>OR<sup>2</sup>]-、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>3</sup>)CO<sub>2</sub>H]-、及びこれらの混合物から選択され；

該Lユニットは、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>4</sup>)C(O)(OCH<sub>2</sub>CH(R<sup>6</sup>))<sub>n</sub>OP(O)(OH)<sub>2</sub>]-、-[CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub>]-、及びこれらの混合物から選択され；

(上式中、R<sup>1</sup>は水素又はメチルであり；R<sup>2</sup>は水素又は炭素原子数1～4のアルキル基であり；R<sup>3</sup>は水素又はメチルであり；R<sup>4</sup>は水素又はメチルであり；そしてR<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>はそれぞれ独立して、水素、メチル、又はクロロメチルであり；mは1～30であり；そしてnは1～15である)；そして、

該コポリマーは、50 wt%～90 wt%の該Kユニットと、10 wt%～50 wt%の該Lユニットとを含む。

【請求項2】

該Kユニットが、該コポリマーの55 wt%～70 wt%であり、そして該Lユニットが、該コポリマーの30 wt%～45 wt%である請求項1に記載の基板。

【請求項3】

該Kユニットが、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>1</sup>)C(O)(OCH<sub>2</sub>CH(R<sup>5</sup>))<sub>m</sub>OR<sup>2</sup>]-から選択され；

該Lユニットが、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>4</sup>)C(O)(OCH<sub>2</sub>CH(R<sup>6</sup>))<sub>n</sub>OP(O)(OH)<sub>2</sub>]-から選択され；

ここで、R<sup>1</sup>はメチルであり；R<sup>2</sup>は水素又はメチルであり；R<sup>4</sup>はメチルであり；R<sup>5</sup>は水素であり；そしてR<sup>6</sup>は水素である請求項1又は2に記載の基板。

【請求項4】

該Lユニットが-[CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub>]-であり；R<sup>1</sup>がメチルであり；R<sup>2</sup>が水素又はメチルであり；そしてR<sup>5</sup>が水素又はメチルである請求項1又は2に記載の基板。

【請求項5】

請求項1～4のいずれか一項に記載の基板と、  
該中間層上の画像形成性層と  
を含んで成る画像形成性要素であって、ここで、  
該画像形成性層は画像形成性組成物を含む。

【請求項6】

該画像形成性組成物が、モノマーとフリーラジカル発生系とを含むネガ型画像形成性組成物である請求項5に記載の画像形成性要素。

【請求項7】

KユニットとLユニットとを含むコポリマーであって：  
該Kユニットが、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>1</sup>)C(O)(OCH<sub>2</sub>CH(R<sup>5</sup>))<sub>m</sub>OR<sup>2</sup>]-、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>3</sup>)CO<sub>2</sub>H]-、及びこれらの混合物から選択され；  
該Lユニットが、-[CH<sub>2</sub>C(R<sup>4</sup>)C(O)(OCH<sub>2</sub>CH(R<sup>6</sup>))<sub>n</sub>OP(O)(OH)<sub>2</sub>]-、-[CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub>]-、及びこれらの混合物から選択され；  
(上式中、R<sup>1</sup>は水素又はメチルであり；R<sup>2</sup>は水素又は炭素原子数1～4のアルキル基であり；R<sup>3</sup>は水素又はメチルであり；R<sup>4</sup>は水素又はメチルであり；そしてR<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>はそれぞれ独立して、水素、メチル、又はクロロメチルであり；mは1～30であり；そしてnは1～15である)；そして、  
該コポリマーが、50 wt%～90 wt%の該Kユニットと、10 wt%～50 wt%の該Lユニットとを含むコポリマー。

【請求項8】

画像形成方法であって、該方法は：  
順番に、支持体、シリケート層、及び中間層を含む基板と、  
該中間層上の画像形成性層と  
を含む請求項5又は6に記載の画像形成性要素を準備し；  
該画像形成性要素を熱画像形成し、そして該画像形成性層内に画像形成された領域と相補的な画像形成されていない領域とを含む画像形成された画像形成性要素を形成し；  
該画像形成された画像形成性要素を現像し、そして該画像形成された領域及び該画像形成されていない領域のうちの一方を除去する  
各工程を含む。

【請求項9】

現像が、インク及びファウンテン溶液で行われる請求項8に記載の方法。